

⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑩ 特許出願公開

⑪ 公開特許公報 (A)

昭55—88332

⑫ Int. Cl.³
H 01 L 21/30

識別記号

府内整理番号
6741-5F

⑬ 公開 昭和55年(1980)7月4日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 3 頁)

⑭ マスク位置合せ方法

川崎市中原区上小田中1015番地
富士通株式会社内

⑮ 特 願 昭53—163175

⑯ 出 願 昭53(1978)12月26日

川崎市中原区上小田中1015番地

⑰ 発明者 岡部正博

⑱ 代 理 人 弁理士 松岡宏四郎

明細書

1. 発明の名称

マスク位置合せ方法

2. 特許請求の範囲

(1) 保持台に設けられたマスクと、該マスクと対向する基板との間隙を所定値とするために、該保持台に設けられた間隙測定器により該基板との間隙を測定しつつ該保持台と該基板とを相対移動せしめるマスク位置合せ方法において、該基板側に初期値検出用間隙測定器を設け、該基板に設けられる基準板との間隙を該初期値検出用間隙測定器で測定し、該初期値検出用間隙測定器の零点調整を行い、次に該基板側を静止し、該初期値検出用間隙測定器により該基板と該マスクとの距離を測定し、この測定結果を該保持台の間隙測定器の初期値として設定することを特徴とするマスク位置合せ方法。

(2) 前記マスクの所定位置に該初期値検出用間隙測定器が間隙を検出しうるよう検知部材を設けたことを特徴とする特許請求の範囲第(1)項記載

のマスク位置合せ方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は微細加工パターンの形成の際、マスクと被膜等部材の設けられる基板との間隙を所定値に位置合せするマスク位置合せ方法に関するもので、特にマスク側に設けられる間隙測定器の初期値設定を容易且つ正確に行いうるよう改良されたマスク位置合せ方法に関するもの。

微細加工の分野において、パターンの形成されたマスクのパターンをX線、光等によりレジストを露布したウェファー上に墨光転写することが行われている。

このようなパターンの転写に当っては、近年のミクロンオーダーの微細加工を行うために、マスクとウェファーを接する基板との間隙を正確に位置合せすることが要求されている。

この間隙は転写の際のパターンのボケ、过大、減少の要因となり、この間隙の設定は特に重要である。

そのため間隙を測定する方法は多数あるが通常

Best Available Copy

マスク側に間隙測定器をとりつけて基板・表面との間隙を検知する方法が一般に行なわれている。

第1図は従来のマスク位置合せ方法の説明図であって、1はマスク、2はリファレンスマラー、3は試料、4は間隙測定器(マイクロセンサ等)、5はマスクバターン、6はマスク保持台を示している。

図に示す間隙測定器4は対向物との静電容量変化又は遮光に対する反射光検知を行って、対向物との距離を測定する周知の測定器である。間隙測定器4はマスク保持台6に設けられ、マスク1と基板3との距離を検知する。

マスク1の厚み、平行度^{±0.1mm}等は一般には、マスク^{±0.2mm}程度で異なるため前記マスク1の保持台6に固定された間隙測定器4は、マスク1を変更するごとに、該マスク1に合せて零点である設定値を変更しなければならない。

そのためリファレンスマラー2と呼ばれる基準器を直接マスク1に接触させ、マスク側にとりつけた間隙測定器4の零点調整を行なっていたので、

特開昭55-883322
マスク1を強制するという危険性があるとともにマスクの反り等によりその精度も悪いという欠点があった。

本発明の目的とするところは、上記欠点に鑑みマスクと基板とを非接触にしてマスク側間隙測定器の設定値を決定するマスク位置合せ方法を提供することにある。

本発明の特徴とするところは保持台に設けられたマスクと、該マスクと対向する基板との間隙を所定値とするために、該保持台に設けられた間隙測定器により該基板との間隙を測定しつつ該保持台と該基板とを相対移動せしめるマスク位置合せ方法において、該基板側に初期値検出用間隙測定器を設け、該基板に設けられる基準板との間隙を該初期値検出用間隙測定器で測定し、該初期値検出用間隙測定器の零点調整を行い、次に該基準板を除去し、該初期値検出用間隙測定器により該基板とマスクとの距離を測定し、この測定結果を該保持台の間隙測定器の初期値として設定することにある。

-3-

-4-

又、本発明の一実施例においては、前記マスクの所定位置に該初期値検出用間隙測定器が間隙を検出しうるよう検知部材を設けたものである。

以下本発明を一実施例につき図面に従って詳細に説明する。

第2図は本発明のマスク位置合せ方法一実施例説明図であって、基板台6の内部に複数個の間隙測定器7を収容する。該基板台6に基準板3をおき、その距離を測定し、各間隙測定器7の零点調節をしておく。

次いで基準板3を外し、マスク保持台9に真空吸着でとりつけたマスク保持台9を移動させマスク1を基板6にある程度に近づける。

マスク1にあらかじめ検知部材としての基準面8をバターンニングしてある。

なお、該基準面8は、間隙測定器7が光を使用する装置であれば鏡面とし、また静電容器を利用する場合にあっては金属薄膜とする。

マスク保持台9を次第に基板台6に近づけ、基板台6の表面がある程度近づいた時にマスク保持

台9を停止し、間隙測定器7の測定値、即ち、マスク1と基板台6との間隙の大きさ、を読み取る。この読み取値をマスク台9にとりつけたマスク側の間隙測定器10の初期値として設定する。

すなわち基板側間隙測定器7の値が2.0μmであればマスク側間隙測定器10の値も2.0μmとなる。この設定は間隙測定器がマイクロメーターであれば、その指針の位置をガリュームで、又はデジタルメーターであれば、テンキー等によって行なう。

マスク側の間隙測定器10が基板台6までの距離が測定しうるように基板台6の表面は金属又は鏡面としておく。この設定後基板台6からマスク保持台9を遠ざける。これとともに間隙測定器10は基板台6との間隙を前述の設定値を始点として測定する。マスク保持台9がマスク1と基板台6間にウェッファーが充分入れる程度離れると停止し、基板台6上にレジストの敷布されたウェッファーが重かれる。

次にマスク保持台9が基板台6に近づくよう移

-5-

-6-

-150-

Best Available Copy

動され、これとともに間隙測定器 10 は基板台 6 との間隔を測定し、この測定値が所定値、例えば 2 μm、となつた時マスク保持台 9 を停止せしめる。

その後マスク 1 を介し X 線を発光し、ウェーファー上にマスクパターンを転写する。

上述の如く、基板側の間隙測定器がマスクと基板間の距離を正確に測定し、これをマスク側の間隙測定器の初期値としてセッティングする。

以上説明したように本発明のマスク位置合わせ装置においては、基板側に間隙測定器を設け、該測定器により、マスクと基板との距離を検知し、該検知情報を、マスク側に設置した間隙測定器に伝達することによって基板との間隔を設定することを可能としたことによりマスクに非接触でマスク側間隙測定器の設定値を決めることができ且つ、マスクの外縁の走りの影響を受けなくなるので測定精度が良くなるとともに IC マスクを破損する危険性もなくなりその効果は極めて大である。

4. 図面の簡単な説明

特開昭55-88332(3)
第1図は従来のマスク位置合せ方法の説明図、第2図は本発明のマスク位置合せ方法の一実施例説明図である。

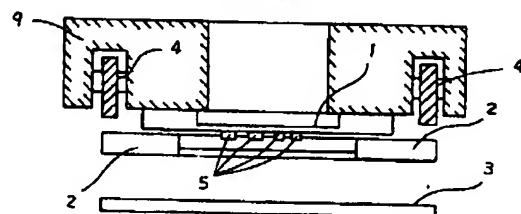
- 1 : マスク
- 2 : リフレンスマラー
- 3 : 試料(基板)
- 4 : 間隙測定器、(マイクロセンサ)
- 5 : マスクパターン
- 6 : 基板台
- 7 : 基板側間隙測定器
- 8 : 基板面
- 9 : マスク保持台
- 10 : マスク側間隙測定器

代理人弁理士 松岡 宏四郎

-7-

-8-

第1図



第2図

